



化学部門で「XAFS 測定による有機半導体薄膜評価に関する講演会」を開催

**【概要】**

2023 年 12 月 8 日（金）に、理工学部化学部門にて、（公財）佐賀県産業振興機構 九州シンクロトロン光研究センターの瀬戸山 寛之 先生による講演会を開催しました。

**【本文】**

2023 年 12 月 8 日（金）に、理工学部 8 号館 5F 国際環境セミナー室にて、（公財）佐賀県産業振興機構 九州シンクロトロン光研究センター（SAGA Light Source, SAGA-LS）の瀬戸山 寛之 先生による「XAFS 測定による有機半導体薄膜評価に関する講演会」と題した講演会を開催しました。

瀬戸山先生は、SAGA-LS にて X 線吸収分光法（XAFS）などを用いて元素選択的に化学状態や配位環境に関する知見を得る研究を行ってきました。今回の講演では、2006 年に稼働を開始した SAGA-LS と、目玉の測定機器である放射光を用いた Tender X 線エネルギー領域の XAFS 測定装置の紹介、硫黄(S)-K 吸収端の Tender-XAFS 測定により有機半導体薄膜デバイスである Top contact 型ジナフト[2,3-b:2',3'-f]thieno[3,2-b]チオノフェン（DNNT）薄膜トランジスタの連続駆動が DNNT の化学状態に与える影響などについて御講演いただきました。また、同測定において、放射光の水平偏光特性を用いた XAFS スペクトルの X 線入射角度依存性から、DNNT 分子が主に基板に対して standing 配向であることを確認したことが述べられました。また、質疑応答ではスペクトル情報や測定条件などについて多くの質問がなされ、聴講者の関心の高さが窺えました。

本講演会は西九州化学工学懇話会主催のもと、化学部門 川喜田 英孝 教授の企画により開催されました。講演は対面のみで行われ、講師と化学部門の教員、学生を含む 18 名が参加しました。



瀬戸山先生による SAGA-LS の紹介